



出願人又は代理人 の登録記号 148458-182	今後の手続きについては、様式PCT/1PEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2004/009152	国際出願日 (日.月.年) 29.06.2004	優先日 (日.月.年) 03.07.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. <sup>7</sup> H01L21/68, B65G49/00		
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社		

1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
 施行規則第 57 条（PCT36 条）の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
3. この報告には次の附属物も添付されている。
- a. ☒ 附属書類は全部で 1 ページである。
- ☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照）
- ☒ 第 1 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
- b. ☒ 電子媒体は全部で 1 (電子媒体の種類、数を示す)。  
 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照)
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- ☒ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎
- ☒ 第 II 欄 優先権
- ☒ 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- ☒ 第 IV 欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第 V 欄 PCT35 条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☒ 第 VI 欄 ある種の引用文献
- ☒ 第 VII 欄 国際出願の不備
- ☒ 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際子偏審査の請求書を受理した日 06.12.2004	国際子偏審査報告を作成した日 19.07.2005
名称及びあて先 日本国特許庁（IPEA/JP） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 中島 昭浩 3U 9147 電話番号 03-3581-1101 内線 3324

第1欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)という国際調査  
☐ PCT規則12.4という国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3という国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づき命令に回答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、  
それ裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1-5	有
	請求の範囲		無
進歩性(1S)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-5	無
産業上の利用可能性(1A)	請求の範囲	1-5	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: J P 2000-150613 A (東京エレクトロン株式会社) 2000.05.30  
 文献2: J P 5-275512 A (株式会社東芝) 1993.10.22  
 文献3: J P 8-293534 A (東京エレクトロン株式会社) 1996.11.05  
 文献4: J P 2002-170860 A (平田機工株式会社) 2002.06.14  
 文献5: J P 6-302679 A (東京エレクトロン株式会社) 1994.10.28

請求の範囲1に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1と国際調査報告で引用された文献2と国際調査報告で引用された文献3とにより進歩性を有しない。

半導体処理装置において、駆動手段から発生する塵埃が被処理体を汚染することは従来周知の課題であり、前記塵埃の影響を低減する手段としてカバー等で覆い、該カバー内を排気することも従来周知の技術手段であることから(文献2、3参照)、これを文献1の蓋開閉機構30の駆動手段である蓋開閉用のエアシリンダ36、屈伸リンク機構37に適用することに格別の困難性は認められない。

請求の範囲2に係る発明は、文献1と文献2と文献3と国際調査報告で引用された文献4とにより進歩性を有しない。

文献1の隔離ユニット18の昇降を行うZ軸エアシリンダ21及び隔離ユニット18の隔壁12への接離を行うカム溝25、カム板26、カムローラ28、Xシリンダ27に換えて、文献4の互いに傾斜面を備えた部材を相対的に昇降させることにより傾斜面どうしの接離を行う機構を用いることに格別の困難性は認められない。

請求の範囲3に係る発明は、文献1と文献2と文献3と文献4とにより進歩性を有しない。

文献1には、蓋ロック部材33は連通口13を閉塞可能な旨記載されていることから(段落0030参照)、蓋ロック部材33と隔壁12との閉塞をより効果的に行うために、シールを隔壁12に設けることは、当業者であれば困難なく想到し得る事項であると認められる。

請求の範囲4に係る発明は、文献1と文献2と文献3と文献4とにより進歩性を有しない。

シールとして、Y字型の断面形状を備えるものは従来周知である。

請求の範囲5に係る発明は、文献1と文献2と文献3と文献4と新たに引用した文献5とにより進歩性を有しない。文献5には、電磁バルブ148を開き、2つの空間を開放して気圧差を無くす点が記載されている(段落0072、図7参照)。

文献1の隔離室17と移動室6との圧力を同じにする手段として、バージポート38、排気ポート39を用いることに換えて、文献5の電磁バルブ148を用いることに格別の困難性は認められない。

また、半導体製造装置において、気流により塵埃が舞い上がることを防ぐために、気流の流れを調整するようにバルブの開度を制御することは従来周知の事項であり、文献5の電磁バルブを徐々に開放することも当業者が必要に応じて適宜なし得る事項にすぎない。